

(資料2) 水質汚濁防止法施行令別表第一関係 汚水等排出施設

水質汚濁防止法施行令別表第一(第一条関係)

特定工場の公害防止組織の整備に関する法律
施行令別表第一(第三条関係)
(有害物質を使用する施設)

- | | |
|---|--|
| <p>2 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設(洗びん施設を含む)。
ハ 湯煮施設</p> <p>3 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水産動物原料処理施設
ロ 洗淨施設
ハ 脱水施設
ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設</p> <p>4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設
ハ 圧搾施設
ニ 湯煮施設</p> <p>5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設
ハ 湯煮施設
ニ 濃縮施設
ホ 精製施設
ヘ ろ過施設</p> <p>6 小麦粉製造業の用に供する洗淨施設</p> <p>7 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設(流送施設を含む)。
ハ ろ過施設
ニ 分離施設
ホ 精製施設</p> <p>8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう</p> <p>9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機</p> <p>10 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設(洗びん施設を含む)。
ハ 搾汁施設
ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
ヘ 蒸留施設</p> <p>11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設
ハ 圧搾施設
ニ 真空濃縮施設
ホ 水洗式脱臭施設</p> <p>12 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設
ハ 圧搾施設
ニ 分離施設</p> <p>13 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗淨施設
ハ 分離施設</p> <p>14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設
ロ 洗淨施設(流送施設を含む)。
ハ 分離施設
ニ 洗ため及びこれに類する施設</p> <p>15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ ろ過施設
ハ 精製施設</p> <p>16 めん類製造業の用に供する湯煮施設</p> <p>17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設</p> <p>18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設</p> <p>18の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 湯煮施設
ハ 洗淨施設</p> | |
|---|--|

- 18の3 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式脱臭施設
 - ロ 洗浄施設
- 19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ まゆ湯煮施設
 - ロ 副蚕処理施設
 - ハ 原料浸せき施設
 - ニ 精練機及び精練そう
 - ホ シルクェット機
 - ヘ 漂白機及び漂白そう
 - ト 染色施設
 - チ 薬液浸透施設
 - リ のり抜き施設
- 20 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗毛施設
 - ロ 洗化炭施設
- 21 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式紡糸施設
 - ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
 - ハ 原料回収施設
- 21の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
- 21の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
- 21の4 パーティクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式バーカー
 - ロ 接着機洗浄施設
- 22 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式バーカー
 - ロ 薬液浸透施設
- 23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料浸せき施設
 - ロ 湿式バーカー
 - ハ 碎木機
 - ニ 蒸解施設
 - ホ 蒸解廃液濃縮施設
 - ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
 - ト 漂白施設
 - チ 抄紙施設(抄造施設を含む)。
 - リ セロハン製膜施設
 - ヌ 湿式繊維板成型施設
 - ル 廃ガス洗浄施設
- 23の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 自動式フィルム現像洗浄施設
 - ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
- 24 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
 - ロ 分離施設
 - ハ 水洗式破碎施設
 - ニ 廃ガス洗浄施設
 - ホ 湿式集じん施設
- 26 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
 - ロ ろ過施設
 - ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
 - ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
 - ホ 廃ガス洗浄施設
- 27 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
 - ロ 遠心分離機
 - ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
 - ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
 - ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
 - ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
 - ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
 - チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
 - リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
 - ヌ 廃ガス洗浄施設
 - ル 湿式集じん施設

一 別表第一第十九号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る)

二 別表第一第二十二号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る)

三 別表第一第二十三号の二に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフィルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る)

四 別表第一第二十四号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る)。

六 別表第一第二十六号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る)。

七 別表第一第二十七号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る)

- 28 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式アセチレンガス発生施設
 - ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
 - ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
 - ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
 - ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
 - ヘ クロロブレンモノマー洗浄施設
- 29 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
 - ロ 静置分離器
 - ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
- 30 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの。
- イ 原料処理施設
 - ロ 蒸りゆう施設
 - ハ 遠心分離機
 - ニ ろ過施設
- 31 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
 - ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
 - ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
- 32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
 - ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
 - ハ 遠心分離機
 - ニ 廃ガス洗浄施設
- 33 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 縮合反応施設
 - ロ 水洗施設
 - ハ 遠心分離機
 - ニ 静置分離器
 - ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
 - ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
 - ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
 - チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
 - リ 廃ガス洗浄施設
 - ヌ 湿式集じん施設
- 34 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
 - ロ 脱水施設
 - ハ 水洗施設
 - ニ ラテックス濃縮施設
 - ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
- 35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 蒸留施設
 - ロ 分離施設
 - ハ 廃ガス洗浄施設
- 36 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 廃酸分離施設
 - ロ 廃ガス洗浄施設
 - ハ 湿式集じん施設

八 別表第一第二十八号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る)

九 別表第一第二十九号に掲げる施設

十 別表第一第三十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)

十一 別表第一第三十二号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る)

十二 別表第一第三十三号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四・ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレート)の製造の用に供するものに限る。)

十三 別表第一第三十四号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは二クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)

十四 別表第一第三十五号に掲げる施設(二クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)

37 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設
- ロ 分離施設
- ハ ろ過施設
- ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
- ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
- ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
- ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
- チ エチレンオキシド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
- リ ニーエチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
- ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
- ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
- ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
- ワ プロピレンオキシド又はプロピレングリコールのけん化器
- カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
- ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
- タ 廃ガス洗浄施設

38 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料精製施設
 - ロ 塩析施設
- 38の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四—ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)

39 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 脱酸施設
 - ロ 脱臭施設
- 40 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

41 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設
 - ロ 抽出施設
- 42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 石灰づけ施設
- ハ 洗浄施設

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
 - ロ 脱水施設
- 45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

46 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 水洗施設
- ロ ろ過施設
- ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
- ニ 廃ガス洗浄施設

47 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 動物原料処理施設
- ロ ろ過施設
- ハ 分離施設
- ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
- ホ 廃ガス洗浄施設

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設

49 農薬製造業の用に供する混合施設

50 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

十五 別表第一第三十七号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。))若しくはエチレンオキシドの製造の用に供するもの又はエチレンオキシドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)

十六 別表第一第三十八号の二に掲げる施設

十七 別表第一第四十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)

十八 別表第一第四十三号に掲げる施設

十九 別表第一第四十六号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含む物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四—ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)

二十 別表第一第四十七号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含む物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四—ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)

二十一 別表第一第四十八号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)

二十二 別表第一第五十号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・四—ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)

- 51 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 脱塩施設
 - ロ 原油常圧蒸留施設
 - ハ 脱硫施設
 - ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
 - ホ 潤滑油洗浄施設
- 51の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
- 51の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設
- 52 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
 - ロ 石灰づけ施設
 - ハ タンニンづけ施設
 - ニ クロム浴施設
 - ホ 染色施設
- 53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 研磨洗浄施設
 - ロ 廃ガス洗浄施設
- 54 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 抄造施設
 - ロ 成型機
 - ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
- 55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
- 56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
- 57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
- 58 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式破碎施設
 - ロ 水洗式分別施設
 - ハ 酸処理施設
 - ニ 脱水施設
- 59 碎石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式破碎施設
 - ロ 水洗式分別施設
- 61 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
 - ロ ガス冷却洗浄施設
 - ハ 圧延施設
 - ニ 焼入れ施設
 - ホ 湿式集じん施設
- 62 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 還元そう
 - ロ 電解施設(熔融塩電解施設を除く。)
 - ハ 焼入れ施設
 - ニ 水銀精製施設
 - ホ 廃ガス洗浄施設
 - ヘ 湿式集じん施設
- 63 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 焼入れ施設
 - ロ 電解式洗浄施設
 - ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
 - ニ 水銀精製施設
 - ホ 廃ガス洗浄施設
- 63の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 64 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
 - ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

二十三 別表第一第五十一号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)

二十四 別表第一第五十三号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研磨洗浄の用に供するものに限る。)

二十五 別表第一第五十八号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)

二十六 別表第一第六十一号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)

二十七 別表第一第六十二号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)

二十八 別表第一第六十三号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)

二十九 別表第一第六十三号の三に掲げる施設

三十 別表第一第六十四号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)

65 酸又はアルカリによる表面処理施設

三十一 別表第一第六十五号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)

66 電気めつき施設

三十二 別表第一第六十六号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)

66の2 エチレンオキシド又は一・四—ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

三十三 別表第一第六十六号の二に掲げる施設

71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

三十四 別表第一第七十一号の五に掲げる施設

71の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

三十五 別表第一第七十一号の六に掲げる施設